

## **Seminario sobre el Sistema de La Haya para el Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales**

**Ginebra, 6 de junio de 2012**

PROGRAMA

*preparado por la Secretaría*

- 9.00 – 9.30           Inscripción
- 9.30 – 9.45           Discurso de bienvenida pronunciado por:
- Sr. Yves Closet, Jefe de la Sección de Información y Promoción, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Ginebra
- 9.45 – 10.15       **Panorama General del Sistema de La Haya**
- Objetivos y características del Sistema de La Haya  
El Acta de Ginebra del Arreglo de la Haya y acontecimientos recientes
- Oradora:   Sra. Päivi Lähdesmäki, Jefa de la Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 10.15 – 11.00       **Presentación de una Solicitud Internacional**
- Derecho a presentar una solicitud internacional  
Idiomas  
Representación ante la Oficina Internacional de la OMPI
- Oradora:   Sra. Sandrine Pitaccolo, Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 11.00 – 11.15       Pausa para el café
- 11.15 – 12.30       **La Solicitud Internacional y el Proceso de Examen**
- Presentación electrónica de solicitudes internacionales (*E-filing*)  
Contenido de una solicitud internacional electrónica  
Reproducciones de dibujos y modelos industriales  
Examen de una solicitud por la Oficina Internacional de la OMPI  
Irregularidades
- Orador:     Sr. Patrick Cartant, Jefe del Servicio de Operaciones, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI
- 12.30 – 14.00       Almuerzo
- 14.00 – 14.45       **Registro Internacional**
- Publicación y aplazamiento de la publicación  
Posibilidad de denegación  
Efectos del registro internacional
- Orador:     Sr. Hiroshi Okutomi, Jurista de la Sección Jurídica, Registro de La Haya, Sector de Marcas y Diseños, OMPI

